

IPO NEWS DIGEST

本資料は、発明推進協会が、諸外国の知的財産庁等の情報を要約したものです。
情報の内容につきましては正確を期すように努めておりますが、正確性を保証するものではありません。本情報の利用の結果発生するいかなる不利益に対しましてもその責任を負いませんので予めご了承願います。

<アメリカ USPTO>

意匠の国際登録に関するハーグ協定加盟 (2015 年 5 月 8 日)

2012 年 12 月 18 日に、2012 年特許法条約実施法 (PLTIA) が、署名され法律として成立しました。PLTIA は、意匠の国際登録に関するハーグ協定の 1999 年ジュネーブ改正協定を実施する条項を示すものであり、2015 年 5 月 13 日に施行される。

ハーグ条約は、直接 WIPO 国際事務局或いは指定国官庁に一つの言語で国際出願することにより、指定加盟国及び政府間組織で 100 意匠まで保護することが可能。

2015 年 5 月 13 日から、出願人は指定国官庁として USPTO を通して、国際意匠出願をすることができ、アメリカを指定国とすることも可能である。2015 年 5 月 13 日以降に出願したアメリカの意匠権は、15 年間保護される。

紹介記事全文(英語) :

<http://www.uspto.gov/patent/initiatives/hague-agreement-concerning-international-registration-industrial-designs>

<カナダ CIPO>

特許データベース改定 (2015 年 6 月 15 日)

2015 年 6 月 15 日、データベースがより使いやすく、特許文書のコレクションを拡充した。特許出願及び登録特許の調査の審査経過も一般閲覧可能。これにより、国内及び海外の発明家や代理人、出願人は、特許文書の情報を包括的に見ることが可能となった。

※この変更に基づき、発明推進協会作成・発行の「[外国産業財産権管理マニュアル](#)」サイト(ユーザー専用)に検索システムの使用方法についての情報を更新する予定です。

紹介記事全文(英語) : <http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr03937.html>

データベース(英語) : <http://www.ic.gc.ca/opic-cipo/cpd/eng/introduction.html>

<欧州 EPO>

統一特許料金割引 (2015 年 6 月 24 日)

6 月 24 日、EPO の特別委員会は、統一特許の更新料の同一設定とする「True Top 4」提案を承認した。「True Top 4」提案とは、EU 加盟国 25 カ国の地域をカバーする統一特許の手数料が、有効化されている欧州特許が最も多い 4 カ国（ドイツ、フランス、英国及びオランダ）に払われている更新料の合計に相当する金額ということになる。

現在の制度では、EPO で特許付与後、各国個別に権利化されなければならない。一方、統一特許の更新料は、単一の手続で行われ、企業にとって費用の節約となる。

EU 加盟国のための統一特許の創設は、40 年以上にわたって待ち望まれていた。この更新料に関する決定によって、欧州の統一特許制度の完了も見えてきた。

具体的にどの位の費用削減になるかという点、最初の 10 年間（欧州特許の平均的有效期間）で、統一特許の場合は EUR5,000（約 68 万円）以下となり、20 年以上の保護の場合でも約 EUR35,500（約 483 万円）となる。比較すると、現在の制度で 25 カ国に支払う手数料は、最初の 10 年間で EUR29,900（約 407 万円）、20 年間ではほぼ EUR159,000（約 2,162 万円）となる。言い換えれば、統一特許の True Top 4 での支払いでは、現在と比べて約 78%の減額となる。

さらに、現在の各国への国内移行費用（翻訳費や弁理士等の費用も含める）も、大幅に減額となり、4 カ国の保護にかかる平均額の 50%となる。

次は、秋頃に、このように集めた更新料をどのように分配するかという議論になる予定。

*換算レート：1EUR=136 円

紹介記事全文(英語)：<http://www.epo.org/news-issues/news/2015/20150624.html>

<タイ DIP>

特許・小特許（実用新案）電子出願化 (2015 年 7 月 1 日)

以下のページにて、特許・実用新案の電子出願が開始された。

※現地協力事務所からの情報：新たに開始されたばかりなので、現在のところエラーが多い状況。出願人は、電子出願手続完了後に、文書でも DIP に提出する必要がある。

※※この変更に基づき、発明推進協会作成・発行の「[外国産業財産権管理マニュアル](#)」サイト（ユーザー専用）に情報を更新する予定です。

紹介記事全文（タイ語）：

http://www.ipthailand.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=1594:2015-07-01-04-12-55&catid=8:news&Itemid=332

手続ページ（タイ語）：（要ログイン）

<https://patentonline.ipthailand.go.th/ePatent/Login2.aspx?ReturnUrl=%2fePatent%2fToDoList.aspx>

<スペイン OEPM>

特許法改正案が議会通過 (2015 年 7 月 27 日)

2015 年 7 月 13 日、特許法改正案が議会で承認された。

改正の主な目的は、国際的な規則と調和させ、法的枠組みを確立することでスペインの特許制度を強化するためである。

主な改正点：

- ・新規性・進歩性に関する事前審査の単一手続を確立し、権利付与制度を改正。
- ・実用新案の保護範囲を化学製品・合成品にも拡大。
- ・特定の企業及び中小企業には 50%の特許出願・調査・審査料金を値下げし、大学には特別割引制度を導入。
- ・職務発明の規則がさらに明確化され、手続きも簡潔化。
- ・公共の利益のために、特許権者による発明の未実施を防ぐための強制実施権の規則を簡素化。

紹介記事全文(スペイン語)：

http://www.oepm.es/es/sobre_oepm/noticias/2015/2015_07_21_AprobadoProyectoLeyPatentes.html

<タイ DIP>

特許・小特許(実用新案)・意匠書類提出期限変更 (2015 年 7 月)

DIP は新たなガイドラインを導入し、以下の書類の提出期限に関する延長請求を制限することを発表した。この新たなガイドラインは政府の新たな促進法の一環として、2015 年 7 月 21 日から実施される。詳細は以下の通り；

	2015 年 7 月 21 日より前	2015 年 7 月 21 日以降
委任状	出願日から 90 日以内+延長 90 日+延長 30 日	出願日から 90 日以内。 (延長不可)
譲渡証 (発明者と出願人間の譲渡証)	出願日から 90 日以内+延長 90 日+延長 30 日	出願日から 90 日以内。 (延長不可)
特許の出願権証明書	出願日から 90 日以内+延長 90 日+延長 30 日	出願日から 90 日以内。 (延長不可)

変更された期限に従わない場合、出願は破棄されたものとみなされる。

※この変更に基づき、発明推進協会作成・発行の「[外国産業財産権管理マニュアル](#)」サイト(ユーザー専用)にこの情報を更新する予定です。

ガイドライン全文(タイ語)：<https://www.info.go.th/?id=12903#guidestep1>

<マレーシア MyIPO>

商標の査定系出願の期限延長手続変更 (2015 年 7 月)

2015 年 7 月 20 日から、査定系手続上の期間延長の申請は、全て関係する担当官に事前に承認を得る必要がある。

IP Online による期間延長申請も、各担当官に知らせること。

査定系手続に関する文書は全て、表紙に「査定系 (EX-PARTE)」と表記する必要がある。

※この変更に基づき、発明推進協会作成・発行の「[外国産業財産権管理マニュアル](#)」サイト (ユーザー専用) にこの情報を更新する予定です。

紹介記事全文 (英語) :

http://www.myipo.gov.my/public-notice/-/asset_publisher/4YIbNbGtsX64/content/notice-about-extension-of-time-eot-for-ex-parte-files-for-trade-mark-division?redirect=http%3A%2F%2Fwww.myipo.gov.my%2Fpublic-notice%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_4YIbNbGtsX64%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1

<インド CGPDTM>

コンピュータプログラム関連特許の審査基準改定版発行 (2015 年 8 月 21 日)

CGPDTM より、コンピュータプログラム関連特許の審査基準改定版が発行され、即日施行された。

「特許局実践と手続きマニュアル」08.03.05.10 章が削除され、代わりに特許法第 3 条(k)に関連するコンピュータ分野の特許審査手順については、審査基準の項目が適用されると追記された。

特許法 第 3 条 発明でないもの

(k) 数学的若しくは営業の方法、又はコンピュータ・プログラムそれ自体若しくはアルゴリズム

http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/pdf/india/tokkyo.pdf

紹介記事全文 (英語) : http://www.ipindia.nic.in/iponew/officeOrder_570001_21August2015.pdf

審査基準 (英語) : http://www.ipindia.nic.in/iponew/CRI_Guidelines_21August2015.pdf

<シンガポール IPOS>

PCT の国際調査・審査機関へ (2015 年 8 月 31 日)

2015 年 9 月 1 日から、PCT ルートの ASEAN 初の国際特許調査及び審査機関としての運営が始まり、国内及び国際事業において、シンガポール経由により多国籍市場への特許出願が迅速化される。

WIPO の管理下で、一つの国際特許出願で 148 カ国に特許の保護を求めることが可能となる。シンガポールは、アジアで五番目 (中国、インド、日本、韓国に続き) に、PCT の国際機関として任命されている 19 の知財庁の 1 つとなる。

ベトナム、メキシコ、ブルネイ、日本、ラオスへの特許出願には、国際調査機関 (ISA) 及び国際予備審査

機関 (IPEA) として、この新たなサービスが利用可能となった。これらの協定は、アジア知財フェア (IP Week @ SG 2015) で署名された二カ国間協定の下で行われた。

紹介記事全文(英語) :

<http://www.ipos.gov.sg/MediaEvents/Readnews/tabid/873/articleid/321/category/Press%20Releases/parentid/80/year/2015/Default.aspx>

<ベネルクス BOIP>

意匠出願の登録手続の改定 (2015 年 9 月 3 日)

BOIP は、2015 年 9 月 3 日から、意匠出願手続について新たな国内制度を開始した。この新たな制度により登録手続は迅速化される。

利用者は、その変更はほとんど気づかないと思われるが、以下の重要な改定を通知する。

- ・意匠の登録証の郵送はされない。登録証は、オンライン登録から出力することが可能。この出力物は、BOIP 発行のコピーと同じ法的効力がある。
- ・ベルギーの意匠登録簿は、2015 年 7 月から図面及びデザインの公式公開媒体である。9 月 3 日から、図面或いはデザインは登録簿上で毎日公開される。

紹介記事全文(英語) :

https://www.boip.int/wps/portal/site/bbie/news/newsitem/lut/p/a1/tVPNcpswEH4V58ARtEgGRG-QsRNcx3XtziTm0hGwBJIGEFmB2k9fnB6adNpxM9PqtJrVfH-rJSI5IKkSnSyFkYOS-M99b9er-lkit0IbuYehWQSTm_85Se6BEbuSUrSXJnWVGSTZRJthf3BRmXBUZAG69dVhzpDg1qqctQJNarQjDSW8mD0Qlmtbnl8vHTqpsC9EKrTokR1ZmlzWZCN728FYwHafhEU9ph6YHO3YHaGrivynGfBNhkb17Lhrs4gOQumn1czBeMh-yvXF1AeHkAfzgr_IrwljSc0AsUS4_MSCqz2unz2gEHYEyBgeeNXeYzxn3wzjYjITFekITjFjVq51kPQ6uMaT9YYEHf985OSuk02tm1FuSVPAl5bHRzej4KC_ZSPTqVqfe_g6qagyEPbyHIZkg2-Cmar6d8cPXlengbxKt17JL100f1AzChIU0ohxl8ng4pLLi3moRL5ib0XwO-X-Hs0m8Zsp07p6c0GjahUQa_DbH9x1Vo65qzo_24uj3N8d4WQGfmd1pH1dfQemy1Tx/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

<カナダ CIPO>

カナダの商標及び意匠が、TMview 及び Designview に追加 (2015 年 9 月 14 日)

国内及び海外の顧客からの要望によって、カナダの商標及び意匠が、OHIM の TMview と Designview に追加された。

CIPO と共に、中国、米国の意匠データも Designview で入手可能となった。

紹介記事全文(英語) :

http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr03967.html?Open&wt_src=cipo-home

TM View (英語) : <https://www.tmdn.org/tmview/welcome.html>

Design View (英語) : <https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome>

* * *